

Oxford Instruments, Plasmalab 80 plus



功能/应用

Plasmalab 80 Plus 是一种等离子处理系统，配置为进行反应离子蚀刻。工艺配方包括蚀刻 SiOx, Si₃N₄ 和多晶硅。该系统非常适用于中试生产，快速原型设计，光电和微电子应用的开发。

规格

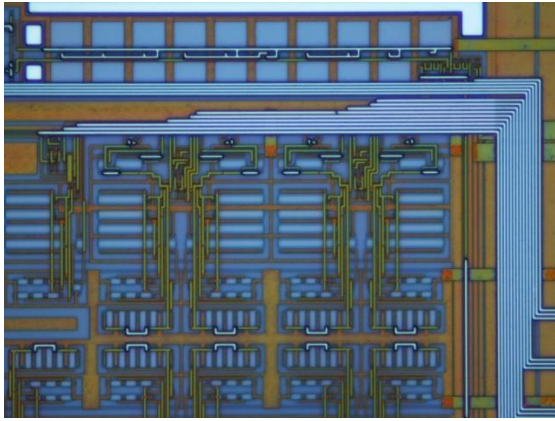
射频功率范围: 50-500 瓦

最大气体流量: 100 sccm

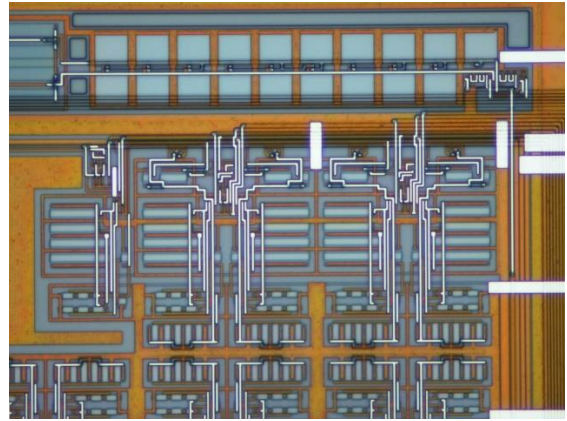
最大样本尺寸: 8 寸晶圆

安装气体: 氧气, 氩气, 四氟化碳

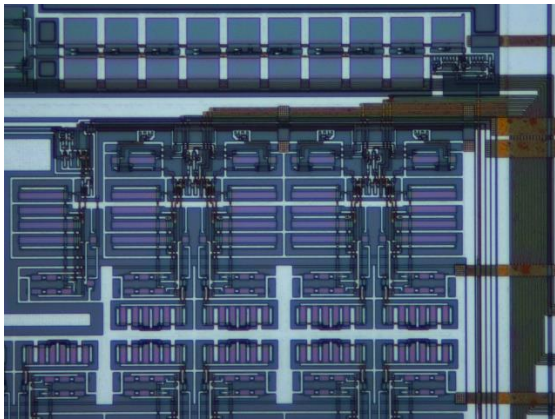
示例应用图片



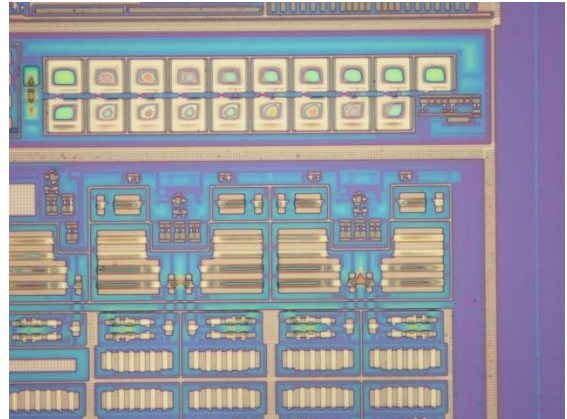
M3 金属层去



除 M3 金属层后



去除 M2 金属层后去



除 M1 金属层后

Youtube 演示视频

https://www.youtube.com/watch?v=u5oh_as9v28